

2024年11月13日

各位

JX金属株式会社

TANIOBIS社ドイツ拠点における高純度金属化合物の開発・生産設備の稼働開始について —半導体向けCVD・ALDプリカーサ材料の製品ポートフォリオ拡充を推進—

JX金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）の関係会社である TANIOBIS GmbH（CEO：石井 雅史、以下「TANIOBIS社」）は、同社ドイツ・ゴスラーの拠点へ次世代半導体向けCVD・ALDプリカーサ材料の開発・生産が可能な設備を導入し稼働を開始しました。

TANIOBIS社のドイツ・ラウフェンブルクの拠点では塩化物を中心とした各種金属化合物を開発・生産していますが、近年の先端半導体需要の高まりを受け、半導体内のきわめて薄い膜の生成や微細配線の形成に利用される高純度CVD・ALDプリカーサ材料の引き合いが増えています。このような背景から、多様な高純度金属化合物の開発推進により製品ポートフォリオを拡充するとともに、増大する需要に対して安定供給できる体制を構築すべく、同国ゴスラーにあるTANIOBIS社の拠点に新たに設備を導入し稼働を開始しました。また、ラウフェンブルクの既存設備については、さらなる生産能力向上による供給力強化と事業継続性の強化を図ります。

当社グループは、半導体向けCVD・ALDプリカーサ材料を次世代の収益の柱とするべく取り組みを進めています。本年6月にも東邦チタニウム株式会社茅ヶ崎工場の敷地内および当社日立事業所白銀地区へ生産設備および開発設備投資を決定しておりますが、本設備増強ではさらなる製品ラインナップ拡充を図ります。加えて、当社がスパッタリングターゲットビジネス等で築いた半導体分野の幅広い知見やネットワークを活用して、グループ全体でCVD・ALDプリカーサ材料事業の拡大に繋げて参ります。

今後も当社グループは、半導体材料・情報通信材料のグローバルリーダーとして、高機能・高性能な先端素材の開発・供給を通して、持続可能な社会の発展と革新に貢献してまいります。

以上

【参考】

2024年6月18日付当社プレスリリース「[次世代半導体向け CVD・ALD 材料の本格生産に向けた能力増強の決定について](#)」



TANIOBIS 社ドイツ・ゴスラーの拠点